

KMPR[®] 1000

化学増幅型アルカリ現像性 ネガレジスト

MICRO CHEM

NIPPON
KAYAKU

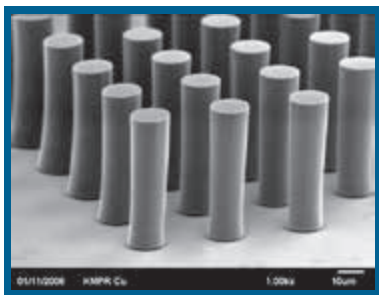
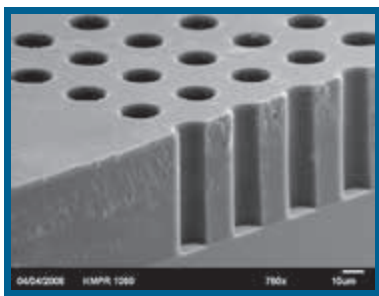
KMPR[®] 1000 はエポキシ樹脂をベースにした剥離タイプのフォトレジストです。厚膜を形成することができるため高アスペクト比の形成が可能です。さらに、密着性、耐薬品性、耐プラズマ性に優れているため、MEMS、電解めっき、ドライエッチングなどに適しています。

特徴

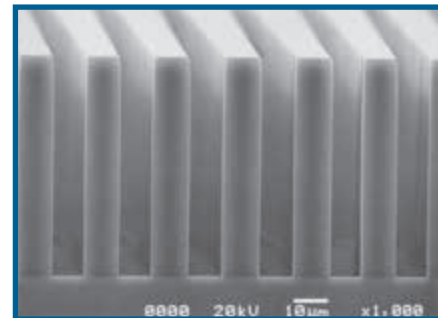
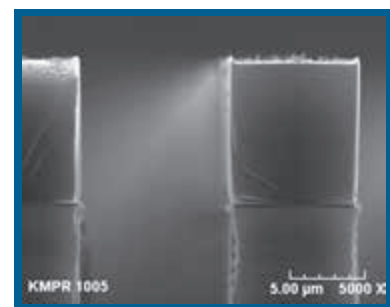
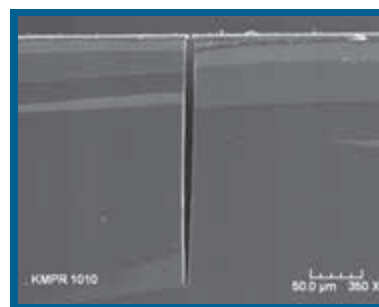
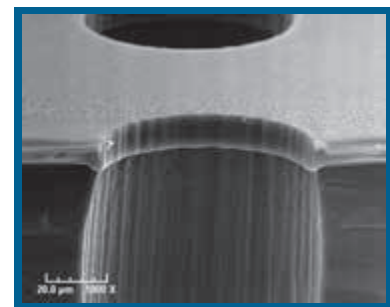
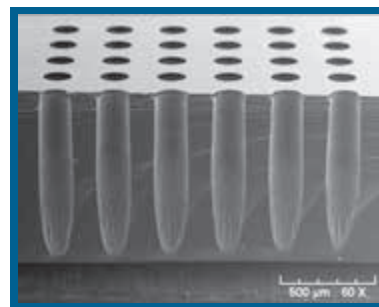
- 厚膜の塗布が可能 (6~120 μ m)
- アルカリ現像 (TMAH 2.38%)
- Remover PG、Remover Kで剥離が可能
- 高アスペクト比
- 優れためっき耐性
- 優れたドライエッチング耐性

使用例

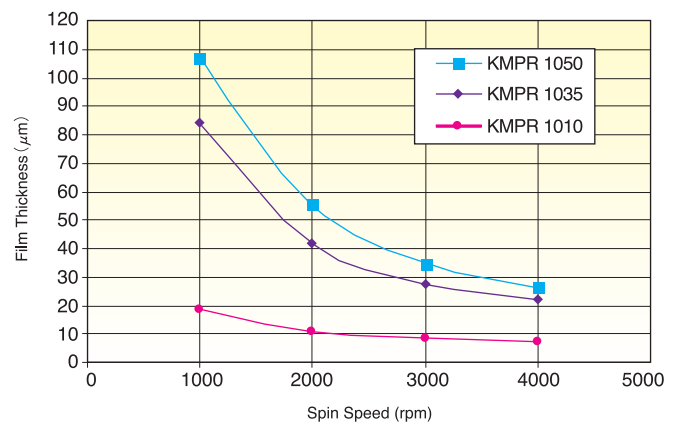
銅めっきモールドとして



DRIE (Bosch プロセス)



露光：コンタクトアライナー (365nm)
L/S = 10/10 μ m 膜厚=60 μ m



(販売元) 日本化薬株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
TEL. 03-6731-5266

製作：KMCC
2008.07.28